

竹内雅耶君 (D2) が JCK-MEMS/NEMS にて最優秀発表賞を受賞

ナノマイクロシステム分野の竹内雅耶君 (D2) が 2018 年 7 月 13 日～7 月 15 日に中国の大連国際コンベンションセンターにて開催された日中韓 MEMS 国際会議(JCK-MEMS/NEMS)にて Best Presentation Award(最優秀発表賞)を受賞しました。この国際会議は世界でも主導的な位置にある東アジア圏での MEMS のさらなる発展と学術的な深化・展開を目的とした東アジア圏最大の国際会議であり2年に一度開催されています。受賞の発表タイトルは”Characteristics of New Deep X-ray Lithography Beamline(BL11) at New SUBARU ” です。

ニュースバル BL11 の加工特性評価及び高い加工均一性を実現した露光システムの制御手法、さらには光化学反応を用いた PTFE 微細加工への展開等が高い評価を得ました。今後の DXL(ディープ X 線リソグラフィ)のキラーアプリケーションや新たな材料開発が期待されます。

